2023년 2월 14일(화), 10:55-12:40
Room H (하트 I, 6층)

B. Patterning (Lithography & Etch Technology) 분과
[TH2-B] Lithography and Photoresist II

좌장: 허수미 교수(전남대학교), 김정식 부장(동진쎄미켐)

TH2-B-1 **10:55-11:25** **[초청]**	**Importance of Rinse Solutions in Photolithographic Processes and Global Research Trends** Su Jin Kang *Youngchang Chemical Co., Ltd.*
TH2-B-2 **11:25-11:55** **[초청]**	**EUV Inorganic Resist Design Strategy** Hyun-Dam Jeong *Chonnam National University*
TH2-B-3 **11:55-12:10**	**High-k 소재 기반 High-NA EUV용 마스크 흡수 소재 연구** 정동민[1,3], 김연수[1,3], 조민선[2,3], 안진호[1,2,3] *[1]한양대학교 신소재공학과, [2]한양대학교 나노반도체공학과, [3]EUV-IUCC (Industry University Collaboration Center)*
TH2-B-4 **12:10-12:25**	**FI Targeting을 위한 DBM 계측 장비 Data 기반 EPE-Based Retarget Rule 자동 생성 기술 개발** Sung Ho Kim, Yeon Ah Shim, Kyung Eun Lee, and Cheolkyun Kim *SK Hynix*
TH2-B-5 **12:25-12:40**	**Adhesion Lithography on Fluoropolymers for Sub-100 nm Channel Gate-Tunable Diodes** Minseo Kim, Seongjae Kim, and Hocheon Yoo *Department of Electronic Engineering, Gachon University*